Photomask Japan 2018

第25回 ホトマスク技術展示会
The 25th TECHNICAL EXHIBITION

展示会招待券 INVITATION

www.photomask-japan.org

主催：ホトマスクジャパン(PMJ) / SPIE
共催：BACUS / EMLC
協賛：SEMI ジャパン

Organized by : Photomask Japan / SPIE
Co-Organized by : BACUS / EMLC
Sponsored by : SEMI Japan

パシフィコ横浜　アネックスホール
2018年 4月18日(水) 10:00 - 17:00
19日(木) 10:00 - 17:00

Annex Hall, Pacifico Yokohama
April 18 (Wed.) 10:00 - 17:00
19 (Thu.) 10:00 - 17:00

Invitation by Courtesy of:

主な出展製品

- ホトマスク
- マスク部材
- レジスト
- EUVL関連
- 製造装置
- 検査装置
- 修正装置
- 試験／測定装置
- 洗浄装置
- CADデータ処理
- シミュレーション
- 出版・サービス

研究・開発、設計、技術、生産・製造、経営・管理に携わる専門家、購買・調達ご担当者に最新技術を提供します。

TECHNICAL EXHIBITION provides the latest technologies to all people in research & development, design, engineering, production & manufacturing, general management, and purchasing & procurement in mask industry.

MAIN EXHIBITS

- Photomask
- Material
- Resist
- EUVL
- Manufacturing
- Inspection
- Repair
- Metrology/Testing
- Cleaning
- CAD Data Process
- Simulation
- Publication/Service

出展社

(株)アストロン
(株)アドバンテスト
稲畑産業(株)
(株)インターソフト
(株)エイチ・ティー・エル
エイビーム・テクノロジーズ・ジャパン(株)
(株)エフエスティー
カールツァイス(株)
兼松PWS(株)
キヤノンマーケティングジャパン(株)
サイバーオプティクスコーポレーション
シグマメルテック(株)
/ アプライドマテリアルズ(株)
芝浦メカトロニクス(株)
(株)ダン・タクマ
TOOL(株)
ニップラテクノデバイス(株)
日本コントロールシステム(株)
日本シノプシス(同)
日本電子(株)
(株)ニューフレアテクノロジー
ハイデルベルグ・インストルメンツ(株)
(株)日立ハイテクサイエンス
ヒューグルエレクトロニクス(株)
(株)堀場製作所
(株)ホロン
マイクロニックテクノロジーズ(株)
松下精機(株)
ルーメスソフト(株)
レーザーテック(株)
列真(株)

2018年4月3日現在

EXHIBITORS

aBeam Technologies Japan, Inc.
ADVANTEST CORPORATION
ASTRON Inc.
Canon Marketing Japan Inc.
Carl Zeiss Co., Ltd.
CyberOptics Corporation
Dan Takuma Technologies Inc.
FINE SEMITECH CORP.
Heidelberg Instruments, KK
Hitachi High-Tech Science Corporation
HOLON CO., LTD.
HORIBA, Ltd.
HTL Co. Japan Ltd.
Hugle Electronics Inc.
Inabata & Co., Ltd.
Intersoft Co., Ltd.
JEOL Ltd.
Kanematsu PWS LTD.
Lasertec Corporation
LAZIN CO., LTD.
Lumes Soft. Co., Ltd.
MATSUSHITA SEIKI CO., LTD.
Mycronic Technologies Corporation
Nihon Synopsys G.K.
NIPPLA TECHNO DEVICE CO., LTD.
Nippon Control System Corporation
NuFlare Technology, Inc.
Shibaura Mechatronics Corporation
SIGMAMELTEC LTD.
/ Applied Materials, Inc.
TOOL CORPORATION

As of April 3, 2018

お問合せ：**Photomask Japan 事務局**　**(株) JTBコミュニケーションデザイン内**
Photomask Japan Secretariat　c/o JTB Communication Design, Inc.
TEL：03-5657-0777　FAX：03-3452-8550　E-mail: pmj-exh@jtbcom.co.jp　www.photomask-japan.org

展示会来場登録用紙 / REGISTRATION FORM for Exhibition

名刺を添えて受付にお持ちください。
Provide complete information and present it at the registration counter with your business card.

COMPLETE OR ATTACH BUSINESS CARD 名刺を貼付又は記入してください

NAME
氏名

COMPANY/ORGANIZATION
勤務先

DEPT/JOB TITLE
所属部署・役職名

COMPANY ADDRESS
会社所在地

PHONE:　FAX:

E-MAIL:

業種 (1) Industry Field

- ☐ 半導体設計 Device design
- ☐ 電気・電子機器製造 Electronics
- ☐ マスク製造 Mask Fabrication
- ☐ 半導体・マスク製造装置 Fabrication equipment
- ☐ 半導体およびマスク材料・部品製造 Materials
- ☐ 検査・修正 Inspection / Repair
- ☐ 半導体およびマスク設計ツール機器 CAD design
- ☐ 商社および販売代理店 Trading Company / Agent
- ☐ 研究・教育機関 Universities / Research Organizations
- ☐ その他 Others (　　)

職種 (2) Job Category

- ☐ 経営者・会社役員 Corporate / General manager
- ☐ 研究・開発 Research & development
- ☐ 生産・製造 Production / Manufacturing
- ☐ 設計 Design
- ☐ 技術 Engineering Support
- ☐ 営業・マーケティング Sales / Marketing
- ☐ 品質管理 Quality Control / Quality Assurance
- ☐ 購買・資材部門 Purchasing / Procurement
- ☐ 検査 Testing / Inspection
- ☐ 教職員・学生 University Professors / Students
- ☐ 報道記者 Press
- ☐ その他 Others

来場の目的 (3) Purpose of Visit

- ☐ 一般の情報収集 Collect information
- ☐ 製品購入のための情報収集 Meet suppliers
- ☐ 製品購入 Place orders
- ☐ 販売代理店／技術提携企業の募集 Find reprensentative / joint ventures
- ☐ その他 Others

次回の展示について (4) Participation in the next exhibition

- ☐ 出展を予定する Would like to exhibit
- ☐ 出展の検討をしたい Would like to consider exhibiting
- ☐ 来場を予定する Would like to visit

ご登録いただいた個人情報に今後Photomask Japanからの情報を送付させていただく場合がございます。希望しない場合は以下のチェックボックスにチェックしてください。

☐ 希望しない

＜同時開催＞ 第25回
国際ホトマスクシンポジウム

Photomask Japan 2018
The 25th Symposium on Photomask and NGL Mask Technology

4月18日(水)- 20日(金)
パシフィコ横浜(アネックスホール)

主　催: ホトマスクジャパン(PMJ) / SPIE
共　催: BACUS / EMLC
後　援: 横浜市 /
応用物理学会 / 精密工学会 / 電気学会
参加費: 60,000円
早期割引: 4/2(月)までに登録の場合は55,000円
※4/18(水)FPDセッション13:20～14:40 のみ参加の場合12,000円
(早期割引10,000円)

April 18(Wed.)- 20(Fri.)
Annex Hall of Pacifico Yokohama

Organized by: Photomask Japan / SPIE
Co-Organized by: BACUS / EMLC
Supported by: City of Yokohama /
JSAP / JSPE / IEEJ
Registration Fee: ¥60,000
Pre-registration by April 2: ¥55,000
*FPD Session April 18, 13:20-14:40 only: ¥12,000
(Early-bird: ¥10,000)

Registration → www.photomask-japan.org

お問合せ: Photomask Japan 事務局
〒105-8335 東京都港区芝3-23-1
セレスティン芝三井ビルディング
(株) JTBコミュニケーションデザイン内
TEL：03-5657-0777　FAX：03-3452-8550
pmj@jtbcom.co.jp

Inquiries: Photomask Japan Secretariat
c/o JTB Communication Design, Inc.
Celestine Shiba Mitsui Bldg. 3-23-1 Shiba, Minato-ku,
Tokyo 105-8335, JAPAN
TEL：+81-3-5657-0777　FAX：+81-3-3452-8550
pmj@jtbcom.co.jp

Symposium Program

The program is based on commitments received by the time of publication and is subject to change without notice.

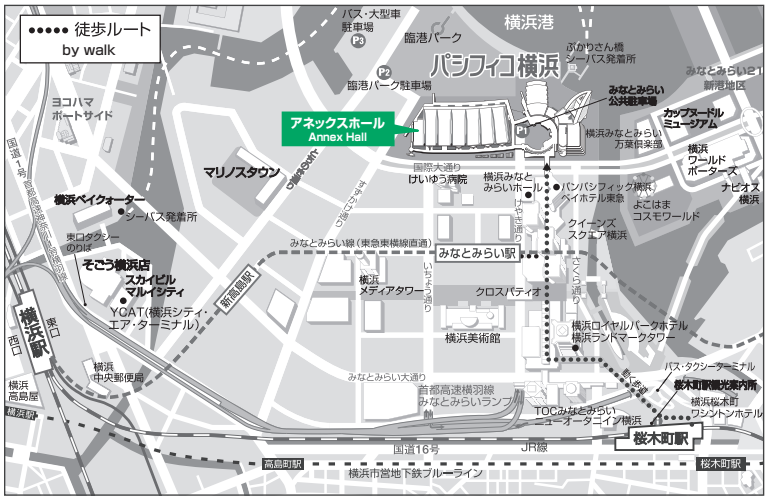
As of February 15, 2018

April 18 (Wed.)		April 19 (Thu.)		April 20 (Fri.)	
10:00 - 10:10	Opening	9:00 - 10:30	Session 6 EUV masks (I)	9:00 - 10:40	Session 10 EUV masks (II)
10:10 - 10:40	Keynote	10:30 - 10:50	Break	10:40 - 11:00	Break
10:40 - 12:10	Session 1 NIL	10:50 - 11:50	Session 7 EUV source for inspection	11:00 - 12:10	Session 11 EUV masks (III)
12:10 - 13:20	Lunch	11:50 - 13:20	Lunch	12:10 - 13:40	Lunch
13:20 - 14:40	Session 2 FPD Photomasks	13:20 - 15:00	Session 8 25th anniversary special session	13:40 - 15:40	Session 12 EUV masks (IV)
14:40 - 15:00	Break	15:00 - 15:20	Break	15:40 - 15:50	Closing
15:00 - 15:50	Session 3 Writing & Metrology	15:20 - 17:00	Session 9 Poster Session 9A: Mask Technologies 9B: Mask/Lithography Related Technologies in Academia		
15:50 - 16:30	Session 4 Process & Repair				
16:30 - 16:50	Break				
16:50 - 18:00	Session 5 EDA & Lithography	17:00 - 20:00	Banquet		

Technical Exhibition

April 18(Wed.) 10:00 - 17:00	April 19(Thu.) 10:00 - 17:00	Please refer to the reverse side.

ACCESS



パシフィコ横浜
〒220-0012　横浜市西区みなとみらい1-1-1
TEL: 045-221-2155
URL: http://www.pacifico.co.jp

PACIFICO YOKOHAMA
1-1-1Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama,
Kanagawa, 220-0012, Japan
TEL: +81-45-221-2155

徒　歩: みなとみらい駅(東急東横線直通みなとみらい線)
クイーンズスクエア方面改札から徒歩5分
桜木町駅から徒歩12分(動く歩道使用)

タクシー: 横浜駅から約10分

バ　ス: 桜木町駅前4番のりばから市営バスにて約11分(「展示ホール」下車)

電　車: 東京方面から横浜駅まで約30分～40分
横浜駅からみなとみらい駅まで約3分
横浜駅から桜木町駅まで約3分(京浜東北線、根岸線快速)

新幹線: 新横浜駅からJR横浜線で菊名駅へ
東急東横線(元町･中華街方面)に乗換―みなとみらい駅まで計約15分

飛行機: 羽田空港からリムジンバスでインターコンチネンタルホテルまで約40分

◆From Minato Mirai Station
5 minutes by walk
◆From Sakuragicho Station
12 minutes by moving walkway / 5 minutes by taxi
◆From Shin-yokohama Station of Sinkansen (bullet train)
15 minutes (Interchange station:Kikuna / Exit station: Minato Mirai)
◆From Tokyo Station
40 minutes by JR Keihin-Tohoku line to Sakuragicho station
◆From Haneda Airport
40 minutes by limousine bus (Bus stop: InterContinental Hotel)